

Máquina De Forno Tubular Pecvd Para Deposição Química Melhorada Por Plasma Inclinado

Número do item: KT-PED



introdução

A máquina de revestimento PECVD da KINTEK fornece películas finas de precisão a baixas temperaturas para LEDs, células solares e MEMS. Soluções personalizáveis e de elevado desempenho.

[Saiba mais](#)

Suporte de amostras	Tamanho	1-6 polegadas
	Velocidade de rotação	0-20rpm ajustável
	Temperatura de aquecimento	≤800°C
	Precisão de controlo	±0.5°C Controlador PID SHIMADEN
Purga de gás	Medidor de fluxo	CONTROLADOR DE CAUDALÍMETRO DE MASSA (MFC)
	Canais	4 canais
	Método de arrefecimento	Arrefecimento por circulação de água
Câmara de vácuo	Tamanho da câmara	Φ500mm X 550mm
	Porta de observação	Porta de visualização total com deflector
	Material da câmara	Aço inoxidável 316
	Tipo de porta	Porta de abertura frontal
	Material da tampa	Aço inoxidável 304
	Porta da bomba de vácuo	Flange CF200
	Orifício de entrada de gás	Conector φ6 VCR
Potência do plasma	Fonte de energia	Potência DC ou potência RF
	Modo de acoplamento	Acoplado indutivamente ou capacitivo de placa
	Potência de saída	500W-1000W
	Potência de polarização	500v
Bomba de vácuo	Pré-bomba	Bomba de vácuo de palhetas 15L/S
	Porto da bomba turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Porta de alívio	KF25
	Velocidade da bomba	Bomba de palhetas:15L/s Bomba turbo:1200l/s
	Grau de vácuo	≤5×10 ⁻⁵ Pa
	Sensor de vácuo	Medidor de vácuo de ionização / resistência / medidor de filme
Sistema de vácuo	Fonte de alimentação eléctrica	AC 220V /380 50Hz

Potência nominal	5kW
Dimensões	900mm X 820mm X870mm
Peso da máquina	200kg